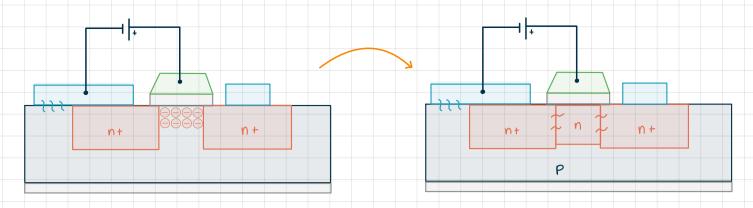


Se **polarizziamo positivamente** il *gate* rispetto al *source*, che è cortocircuitato al body quindi andiamo a polarizzare anche il body, la parte del body in prossimità all'isolante del gate si comporterà come l'**armatura di un condensatore**, e quindi si andranno a posizionare un gran numero di cariche negative (**elettroni**).

Ma siccome il semiconduttore di tipo "p" è per definizione (e costruzione) ricco di lacune (anche se viene arricchito e quindi si aggiungono degli elettroni, ma sempre pochi sono) esso solitamente **non conduce**. Ma se forziamo i suoi (pochi) elettroni a concentrarsi tutti in un'unica zona (solitamente sono "sparpagliati lungo tutto il volume) esso **diventa a tutti gli effetti un semiconduttore di tipo "n"**.

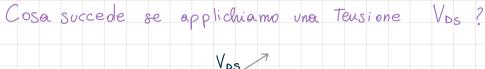
Come risultato otteniamo quindi che la piccola zona al di sotto del gate **diventa una zona di tipo "n"**, e quindi **condurrà corrente!** 

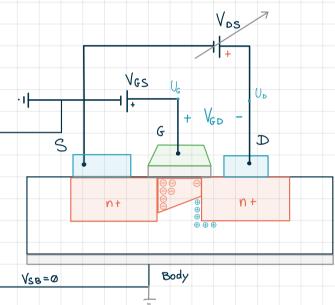


Il valore di Vgs (ovvero la tensione positiva tra gain e source) per cui viene a crearsi il canale centrale di tipo n, è detto **Treshold Voltage Tv.** Al di sotto di questo valore non ci sarà conduzione di corrente tra G ed S, ed al di sopra di questo voltaggio, invece, la conduzione tra G ed S aumenterà direttamente rispetto alla tensione Vgs.

#### **IMPORTANTE**

In queste condizioni si viene a creare un canale p tra drain e source, ma **non può circolare corrente**, dobbiamo quindi completare il circuito:





Siccome la tensione Vds porta delle cariche positive sul terminale D, queste si disporranno nei pressi della zona n corrispondente a D, andando quindi a creare una zona dove ci sarà **minore conduzione elettrica** rispetto alla zona n del terminale S.

Aumentando la tensione Vds andiamo a <u>limitare</u> il passaggio di corrente: essa non aumenterà più, m nemmeno diminuirà! **Rimarrà** 

Ouindi Us=0=0 VDG=VG-VD

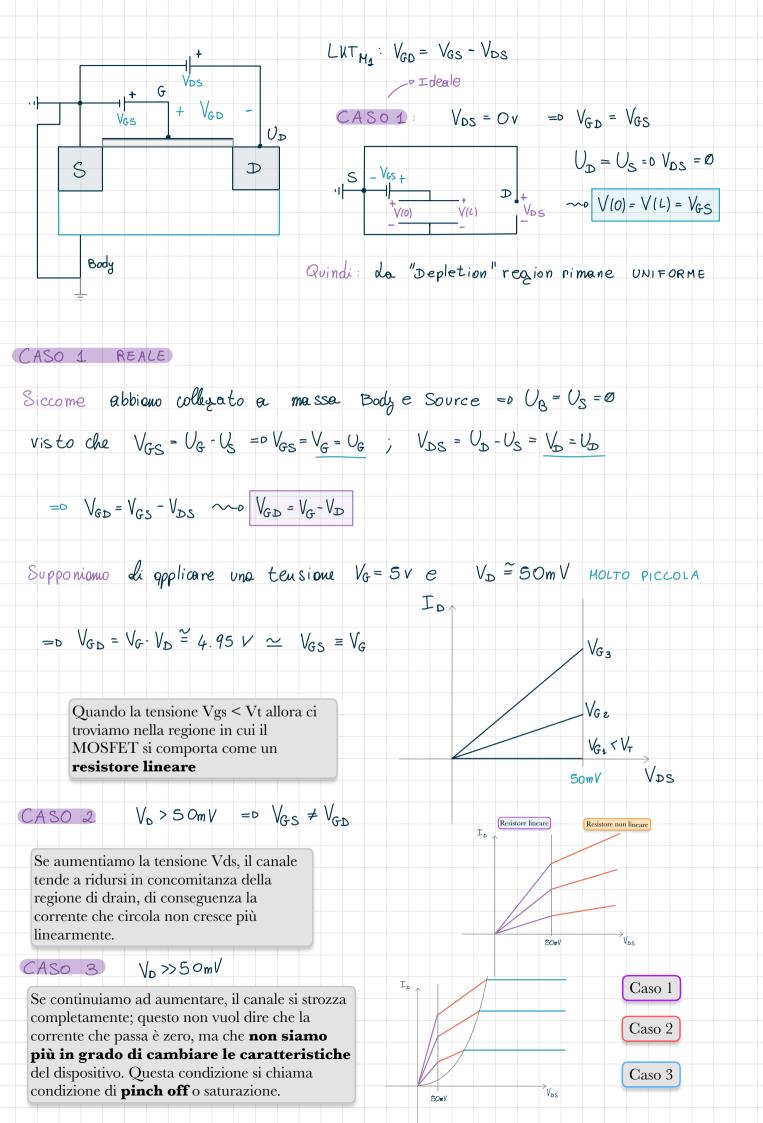
Nel frattempo VGS Rimane costante perche

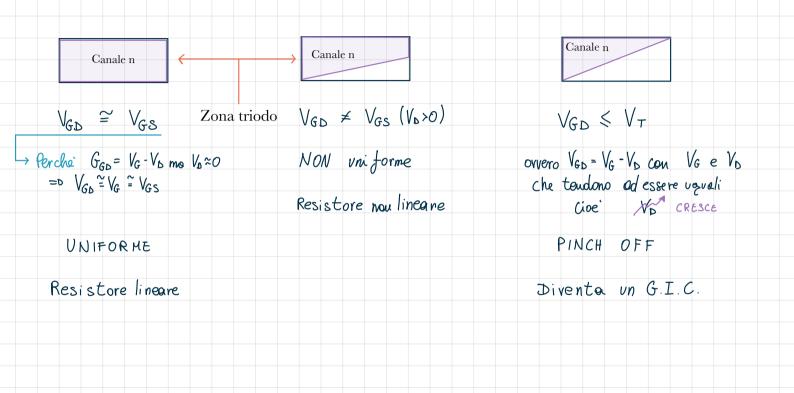
Se aterra => la parte di source continuo ad attirare ali stessi clettroni di prima.

La regione D attirerà meno elettroni della zona S, quindi S condurrà "meglio" di D.

Ad un certo punto, avremo che la zona di D <u>non</u> <u>attirerà più elettroni</u>, e di conseguenza la conduzione di corrente non continuerà ad aumentare. Questa tensione prende il nome di **tensione di saturazione Vds(sat)** 

Treshold Voltage
$$V_{DS}(SAT) = V_{GS} - V_{T} \quad \text{ovvero} \quad V_{G} - V_{D} = V_{T}$$





### EQUAZIONI DELLE CURVE

#### · INTERDIZIONE

Questa zona corrisponde allo "switch aperto", non passa corrente e quindi c'è tensione

G

#### · ZONA TRIODO PINCH OFF

$$V_{GS} > V_{T}$$

#### ZONA TRIODO: Passo corrente

Ovvero la corrente tra drain e source non passa completamente, ma è strozzata da un resistore (il mosfet)

## Dipende dalla Mobilità deali / costruzione

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{0x}$$

$$\left[ 2 \left( V_{os} - V_{\tau} \right) V_{DS} - V_{DS} \right]$$

# Capacità dell'ossido ( Cox = Eox - Permeabilità Elettrica Spessore ossido

Nella zona di saturazione possiamo vedere il MOSFET come un generatore di corrente controllato in tensione

In questa zona possiamo aumentare Vds quanto ci pare ma non aumenterà la corrente che attraversa il mosfet; la Vds superflua viene dissipata in calore (persa).

Per ottenere l'equazione della corrente della zona pinch off mi basta sostituire a Vds la tensione di saturazione ovvero Vds=Vgs-Vt

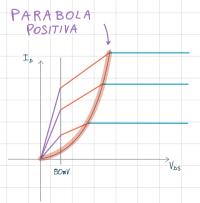
$$I_{D} = \frac{1}{2} \mu_{n} C_{ox} \cdot \frac{\omega}{L} \left[ 2 (V_{GS} - V_{T}) (V_{GS} - V_{T}) - (V_{GS} - V_{T})^{2} \right] = \frac{1}{2} \mu_{n} C_{ox} \cdot \frac{\omega}{L} \cdot (V_{GS} - V_{T})^{2}$$

#### Possiamo trovare la curva che divide la zona triodo dalla zona pinch-off

-o sostitisco nella 2 
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot \frac{\omega}{L} \left( V_{DS(SAT)} - V_T + V_T \right) = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \cdot \frac{\omega}{L} V_{DS(SAT)}^2$$

#### Cosa succede nella zona triodo per valori di Vds molto piccoli?

$$= \circ \quad \mathsf{R}_{\mathsf{MOS}} = \frac{\mathsf{V}_{\mathsf{DS}}}{\frac{1}{2} \, \mu_{\mathsf{n}} \, \mathsf{Cox} \cdot \frac{\mathsf{w}}{\mathsf{L}} \, \left[ \, \frac{2}{2} (\mathsf{V}_{\mathsf{GS}} - \mathsf{V}_{\mathsf{T}}) \, \mathsf{V}_{\mathsf{DS}} \, \right]} = \frac{1}{\mu_{\mathsf{n}} \, \mathsf{Cox} \, \frac{\mathsf{w}}{\mathsf{L}} \, \left( \, \mathsf{V}_{\mathsf{GS}} - \mathsf{V}_{\mathsf{T}} \right)}$$



## Considerazioni

Quando abbiamo un generatore di tensione di prova in ingresso al gate, questo vede una **resistenza infinita** visto che il gate è isolato dallo strato di ossido rispetto a drain e source.

Sempre questo strato di ossido, però, **crea un condensatore**; questo ha come conseguenza il fatto che il MOSFET diventa a tutti gli effetti un dispositivo **dinamico**.

Inoltre, la curva che separa la zona triodo dalla zona pinch-off, può essere graficata rispetto alla tensione Vds oppure alla tensione sul gate Vgs. Si preferisce Vgs perché mostra chiaramente che questa curva non parte da zero ma dalla tensione di threshold!

